



NEUTRONIX / QUINTEL

685A Jarvis Drive, Morgan Hill, CA 95037 Ph: (408)776-5190 Fax: (408)776-1039

THIẾT BỊ IN VI MẠCH LÊN ĐẾ WAFER Q 4000-4 MASK ALIGNER

NXQ 4000-4 Mask Aligner là sự kết hợp với thiết kế hiện đại cùng với sự đồng chỉnh chính xác và tính năng chiếu sáng.

Thiết bị cho phép tiến hành chiếu sáng ở cả một tiếp xúc và chân không với sự chính xác cao đồng thời có thể làm việc trên một phân hoặc cả phiến silicon với đường kính lên đến 100mm (4 inches).

Những tính năng vượt trội của NXQ-4000-4 đã làm nó trở thành lựa chọn của các cơ sở sản xuất, các trung tâm Nghiên cứu và Phát triển và các trường Đại học trên thế giới, phục vụ nhiều loại hình công nghệ.





NEUTRONIX / QUINTEL

685A Jarvis Drive, Morgan Hill, CA 95037 Ph: (408)776-5190 Fax: (408)776-1039

Đặc tính kỹ thuật

- Kích thước đế từ rất nhỏ đến tấm silicon đường kính 100mm (4")
- Cần điều khiển X-Y và bàn vi chỉnh theta (chỉnh méo)
- Mâm tải thủ công dễ dàng cho việc tải hay dỡ tải đế silicon.
- Các chế độ chiếu sáng chân không/tiếp xúc
- Kính hiển vi trường đơn/ trường tách rời VariView với tính năng phóng đại (tùy chọn hiển thị dùng màn hình màu CCTV)
- Tải mặt nạ (mask) đơn giản
- Ổn định nguồn Vari-Watt cho hệ UV
- Các thấu kính chuẩn trực dùng tia cực tím để tăng độ phân giải khi quang khắc
- Bàn giảm chấn cho phép khử những rung động trong quá trình thao tác
- Vận hành dễ dàng- thích hợp cho các phòng thí nghiệm nhiều người sử dụng
- Chi phí bảo trì thấp

Tùy chọn

- Đồng chỉnh mặt dưới bằng hồng ngoại
- Chiếu sáng dùng đèn gần tử ngoại NUV (bước sóng từ 280-350nmHg)
- Mâm đỡ phiến (hai mâm) cho các phiến 4 inch
- Vi chỉnh X-Y thủ công
- Lựa chọn màn hình màu (CCTV) cho kính hiển vi MagnaView
- Định thời chiếu sáng bằng xung

Tính năng

Các chế độ in (quang khắc)

- Các chế độ chân không, áp suất (hay tiếp xúc), mềm

Độ phân giải khi in

< 1.0 micron (với tiếp xúc chân không)

Kích thước đế

Từ các miếng nhỏ đến 100mm (4 inch)



NEUTRONIX / QUINTEL

685A Jarvis Drive, Morgan Hill, CA 95037 Ph: (408)776-5190 Fax: (408)776-1039

Bàn điều chỉnh:

- Di chuyển trên X-Y
- Di chuyển trên trục theta (chỉnh méo)
- Bàn quét
- Phạm vi dịch chuyển X-Y
- Phạm vi quay theta
- Phạm vi dịch chuyển trên trục Z
- Khoảng cách giữa mặt nạ/phiến
- Kích thước mặt nạ
- Che phủ mặt trên*
- Che phủ mặt dưới*

* Tùy theo sự xử dụng của nhân công

Cần điều khiển thủ công

Cần điều khiển thủ công với sự xô dịch rất nhỏ

+/- 16mm

+/- 3.8 mm

+/- 7⁰

< 0.05 microns

0-180 micron

2.5x2.5" đến 5x5"

<=1.0 microns

> 2microns

Phần điện tử

- Lập trình và điều khiển PLC

Với màn hình LCD

Giao diện vận hành cảm biến để điều khiển các chế độ của máy

Phần quang học dùng đèn UV có vỏ/UV thường

- UV có vỏ Lamphouse
- Bước sóng UV
- Độ đồng đều của nguồn UV

Công suất 200/350W

Chuẩn 350-450 nm

+/- 3%, trên phiến 4"

Yêu cầu hệ thống

- Công suất
- Khí nén
- Chân không
- Nitơ (hoặc Argon nén)

110VAC,/60 Hz hoặc 240VAC 50Hz

5.4 bar (80 PSI)

0.7 bar (21" Hg)

3 bar (40 PSI)

Hệ thống/Môđun dữ liệu

- Rộng x Sâu x Cao
- Khối lượng

48" x 36" x 50"

217Kg (480 Lb)

www.acrosemi.com



Thông Tin Liên Hệ:

USA - Phone: (714) 468-9034 Fax: (866) 212-8857

E-mail: info@acrosemi.com

Vietnam - Phone: (+84-0) 91-225-7173

Email Ho Chi Minh Office: hcmc@acrosemi.com

Email Ha Noi Office: hanoi@acrosemi.com